CO。レーザを用いた液晶表示用ガラスおよびサファイアの熱応力割断

金沢大学大学院 藤江典久,上田隆司,細川晃,広島大学山田啓司,澁谷工業(株) 三野大樹

Thermal Stress Cleaving of Glass and Sapphire by CO, Laser

Kanazawa University Norihisa Fujie, Takasi Ueda, Akira Hosokawa,

Hirosima University Keiji Yamada, Shibuya Kogyo, Itd Daiki Mino

Thermal stress cleaving is a prospective technique for separating a wafer or thin plate from brittle materials such as glasses and ceramics. In this paper, the cleaving mechanism of a glass and a sapphire irradiated with CO_2 laser is investigated. A high frequency pulsed laser is used for the purpose of investigating the mechanism of crack propagation more precisely. The AE signal is measured to examine the characteristics of crack propagation. Thermal damage to the surface of the glass causes the deterioration of cleaving accuracy. Consequently, it is important to minimize the thermal damage by controlling the prosess parameters.

1.緒言

近年,セラミックスや,ガラス等の脆性材料の切断法と して,従来のダイヤモンドブレードダイシングに比べて切 り代が小さく,清浄な加工が可能なレーザ熱応力割断が注 目を集めている.しかしながら,レーザ照射に伴う温度上 昇によって加工物に副き裂などの熱損傷が起こることが問 題となっている.

そこで本研究では、パルス CO₂ レーザを用いて液晶表示 用ガラスおよびサファイアの直線割断実験を行い、レーザ パワー、デフォーカス、送り速度などの加工条件による加 工品質へ及ぼす影響を検討した.

2. 熱応力割断の原理

レーザを加工物に照射すると,照射部は急激に温度が上 昇し,熱膨張する.これにより,レーザ照射部には圧縮応 力場が,その周辺部分にはこれと釣合うように引張応力場 が発生する.この引張応力場にき裂の先端がある場合,応 力は円周方向に働くため,き裂先端は照射部中心に向かい 進展する.そこで,加工物に一定の送りを与えることによ りレーザ照射部を移動させ,き裂の進展を追従させること で加工物を分断する.



Fig.1 Experimental set up

3.液晶表示用ガラスの割断実験

3.1 実験方法 図1に実験装置の概略図を示す.加工物は 液晶表示用ガラスを用い,片もちの加工物保持台に固定し ている.一定の送り速度 / でステージを移動させ,CO₂ レー ザ光を加工物上に走査し割断を行う.図2に試料寸法を示 す.液晶ガラスには図に示す位置にビッカース圧子を用い ての初期き裂を導入している.

3.2 df 量による割断への影響 表1のAに実験条件を示 す.送り速度を V=5mm/s で固定し,各デフォーカスにおい てレーザパワーを変化させて割断実験を行った.図3に レーザパワー Q=15W, df=+15mm および df=+30mm で割断し た時の照射面と割断面写真を示す.df=+15mm では照射面 に副き裂が発生し,割断面の照射面側にレーザ照射による 熱損傷部分があることがわかる.df=+30mm では熱損傷の 無い良好な加工結果を得ることができる.

次に加工後の割断面の平均粗さ R_aを触針式粗さ計を用い て測定した.図4に df=+15mm と df=+30mm の測定結果を示 す.図から df=+15mm ではレーザパワーが小さい時は粗さ も小さいが、レーザパワーが大きくなると粗さも大きく なっている.それに対して df=+30mm ではレーザパワーを 上げても粗さは小さい.

3.3 送り速度による割断可能条件 表1のBに実験条件 を示す.dfを+15mmで固定し,送り速度,レーザパワーを 変化させ割断を行った.図5に割断可否結果を示す.図に 示されるように送り速度を上げると割断に必要なレーザパ ワーは大きくなることがわかる.

Table.1 Experimental conditions (Glass)

		Pre-crack /	aser irradiation path
	mm	Feed direction	
	Ξ.	<i>t</i> =1.1mm	
		20mm	

Fig.2 Size of spcimen

			Experiment A	Experiment B
Specimen :		Crystal liquid glass		
Installation of pre-crack :			Vickers indenter	
Feed rate :	V [[mm/s]	5	5,10,15
Size : [mm]		[mm]	20×20×1.1	
Laser :			CO ₂ laser	
Irradiation mode			Pulse in	adiation
Wavelength :	λ	[µm]	10).6
Pulse fequency	f	[Hz]	200	
Defocus :	df	[mm]	+8,+12,+15,+30	+15
Average power :	Q	[W]	6~30	4~35







Fig.4 Relationship between laser power Q and Fracture roughness



Fig.5 Influence of both feed rate and laser power on cleaving



Fig.6 Sapphire specimen

4.サファイアの割断実験

<u>4.1 実験方法</u>本実験では,実験材料として図6に示す結 晶方位<0001>のサファイアを用いた.レーザ照射面は (0001)面で加工物送り方向は<2110>方向である.表2にサ ファイアの物性値を示す.試料はアルミ板の上に載置して 送り与えてレーザを照射している.初期き裂は9.81Nの荷 重で試料始端から200,100,100µm間隔で3個ビッカース 圧子を打ち導入した.表3に実験条件を示す.

4.2 実験結果 図7に試料の割断後の顕微鏡写真を示す. 照射面,割断面ともに熱損傷のなく,良好な割断ができて いる.サファイアにおいてもガラスの時と同様に,デ フォーカスを与えることで表面の熱損傷を抑えることがで きることがわかる.

5. 結言

(1) デフォーカスによって照射面積当りのエネルギ密度を を変化させることで,ガラス・サファイア共に副き裂など の熱損傷の無い割断ができる.

(2) 送り速度を上げると必要なレーザパワーは上がる.



Fig.7 Picture of specimen(V=15mm/s,Q=3W,df=+5mm)

Table.2 Material properties of sapphire

Thickness of specimen	t (μm)	120
Young module	(Gpa)	4.7×10^{4}
Thormal avaantion	$(1/\mathbf{K})$	5.3×10 ⁻⁶ C//
Thermal expantion	(1/ K)	$4.5 \times 10^{-6} C \perp$
Thermal conductivity	(W/m•K)	41.9
Specific heat	(J/kg•K)	760
Vickers hardness	(Mpa)	19292
Fracture toughness	K_c (Mpa·m ^{1/2})	1.36

Table.3 Experimental conditions (Sapphire)

Laser	CO ₂ laser
Irradiation mode	Pulse
Pulse frequency $f(Hz)$	200
Defocus $df(mm)$	+5
Laser average power $Q(W)$	3
Feed rate $V(\text{mm/s})$	15